

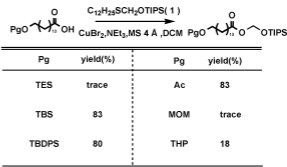
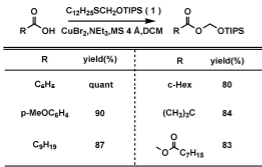
# 29E02-am07S

カルボン酸の TIPS オキシメチルエステル保護

○吉村 光<sup>1</sup>, 江藤 康平<sup>1</sup>, 高橋 圭介<sup>1</sup>, 石原 淳<sup>1</sup>, 畑山 範<sup>1</sup> (長崎大院医歯薬)

【目的】我々は、最近、OxazolomycinA の全合成<sup>1)</sup>の途上で、穏和な条件下カルボン酸をトリイソプロピルシリロキシメチル (TIPSOCH<sub>2</sub>) 基で保護する伊藤らの方法<sup>2)</sup>を改良した。今回、その改良法の一般化及び基質適用範囲を調べるために本研究に着手した。

【方法・結果】TIPSOCH<sub>2</sub> 基は L-Selectride や接触水素添加に対し安定でありながら、HF-pyridine 存在下で脱保護される。今回、種々のカルボン酸を無臭の試薬(1)と CuBr<sub>2</sub>・NEt<sub>3</sub>、MS4 Å 存在下、CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub> 中で反応すると、いずれも良好な収率で対応するカルボン酸保護体が見出された。本発表では、基質適用範囲についても併せて報告する。



1) S. Hatakeyama *et al.*, *Org.Lett.* **2011**, *13*, 5398.

2) D. Sawada, Y. Ito, *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 2501.